

株式会社 京都銀行

京都市下京区烏丸通松原上る
郵便番号600-8652

「京銀輝く未来応援ファンド2号」第4号案件への投資について ～パワー半導体の開発販売を行う京大発ベンチャー「株式会社 FLOSFIA」へ投資～

京都銀行（頭取 土井 伸宏）が、2019年2月にグループ会社の京銀リース・キャピタル株式会社（代表取締役社長 奥野 浩）と共同で設立した「京銀輝く未来応援ファンド2号投資事業有限責任組合（略称：京銀未来ファンド2号）」は、第4号投資案件として、「株式会社 FLOSFIA」へ投資いたしました。

「株式会社 FLOSFIA」は、同社の独自技術「ミストドライ[®]法」を活用し、新たなパワー半導体「コランダム構造酸化ガリウム（ α -Ga₂O₃）」の開発・販売、金属酸化膜等の成膜・コーティングを行う、京都大学発のベンチャー企業です。同社のパワー半導体は、電源・車載・動力分野だけでなく幅広い産業領域でのイノベーションを可能にし、事業化の進展により、機器の電動化、小型化、損失低減を通じた省エネ社会の実現が期待されています。

京都銀行グループでは、将来成長が期待できる創業企業やベンチャー企業、中小企業のほか、事業承継ニーズを有する中小企業等に投資を行う当ファンドを通じ、幅広いステージの企業を積極的に支援し、今後もさらなる地域経済の活性化と地域創生に貢献してまいります。

記

1. 投資先概要

企業名	株式会社 FLOSFIA
代表者	代表取締役 人羅 俊実
本社所在地	京都市西京区御陵大原1番29号 マイコムビル1階・3階
設立	2011年3月31日
事業内容	ミストドライ [®] 成膜技術を活用した、「パワーデバイス事業」「成膜ソリューション事業」の展開。（京大技術シーズの事業化） ・パワーデバイス事業：酸化ガリウム系パワー半導体の研究・製造・販売 ・成膜ソリューション事業：金属酸化膜等の成膜・コーティング

2. 投資について

京大発の技術「ミスト CVD 法」を独自に発展させた「ミストドライ[®]法」を基礎技術として、コランダム構造酸化ガリウム (α -Ga₂O₃) パワー半導体の開発販売や金属酸化膜等の成膜・コーティングを行う「株式会社 FLOSFIA」に、製品の開発・製造および量産化に向けた資金として投資を行う。

※ミストドライ[®]法とは

ミスト（霧）を使って薄膜を原子層レベルで積層していく技術で、京都大学工学研究科の藤田 静雄教授の研究グループが開発した「ミスト CVD 法」を、株式会社 FLOSFIA が独自に発展させたもの。当技術の活用により、半導体単結晶の高品質化、金属膜や有機膜の重合などが実現している。「ミストドライ[®]」は FLOSFIA の登録商標である。

※コランダム構造酸化ガリウム (α -Ga₂O₃) パワー半導体とは

「ミストドライ[®]法」で作製した新材料「コランダム構造酸化ガリウム (α -Ga₂O₃)」を用いて開発したパワー半導体（電力の変換等に用いられる電力用半導体）。酸化ガリウムの特性を引き出すことで、機器の電動化、小型化のほか、変換損失の軽減による電力ロスの抑制を可能にする、新たなパワー半導体として期待されている。

3. 京銀輝く未来応援ファンド2号の概要

名 称	京銀輝く未来応援ファンド2号投資事業有限責任組合 (略称：京銀未来ファンド2号)
投資対象	当行営業エリア内に本社を置く以下の企業 ・独自技術や新規性のあるビジネスモデルを有し、将来成長が期待できる創業企業やベンチャー企業、中小企業等 ・後継者不在など事業承継ニーズを有する中小企業等
出 資 者	無限責任組合員 (GP)：京銀リース・キャピタル株式会社 有限責任組合員 (LP)：株式会社 京都銀行
ファンド総額	10億円
当行出資額	9億90百万円
設 立	2019年2月25日
存続期間	10年 (ただし、合意により2年間の延長可能)

以 上